# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

**SVERIGE** 

**PATENTSKRIFT** 

C2

(11) 517 440

(19) SE

(51) Internationall klass 7 H01L 29/93



REGISTRERINGSVERKET

(21) Patentansöknings-

(45) Patent meddelat 2002-06-04

(41) Ansökan allmänt tillgänglig 2001-12-21

(22) Patentansökan inkom 2000-06-20 Ansökan inkommen som:

(24) Löpdag 2000-06-20

(62) Stamansökans nummer

(86) International ingivningsdag

(86) Ingivningsdag för ansökan om europeisk patent

(83) Deposition av mikroorganism

(30) Prioritetsuppgifter

nummer 0002296-2

svensk patentansökan fullföljd internationell patentansökan med nummer

omvandlad europeisk patentansökan

med nummer

(73) PATENTHAVARE Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ),

126 25 Stockholm SE

(72) UPPFINNARE

Spartak Gevorgian, Göteborg SE, Zdravko Ivanov, Göteborg SE, Peter Petrov, Göteborg SE, Erland Wikborg, Danderyd SE

(74) OMBUD

**PATENT- OCH** 

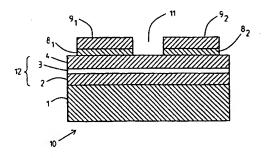
Cegumark AB

(54) BENÄMNING

Elektriskt avstämbar anordning och ett förfarande relaterande därtill

- (56) ANFÖRDA PUBLIKATIONER: - -
- (57) SAMMANDRAG:

Föreliggande uppfinning relaterar till en ferroelektrisk tunnfilms-varaktoranordning (10) som består av ett substratlager (1), en ferroelektrisk lagerstruktur (12) och en elektrodstruktur  $(9_1, 9_2)$ . Den ferroelektriska lagerstrukturen (12) består av ett antal ferroelektriska lager (2,4) och ett antal mellanliggande buffertlager (3) som är anordnade på ett alternerande sätt. Åtminstone ett första (2) och ett andra (4) lager av sagda ferroelektriska lager har olika Curie-temperaturer, dvs den dielektriska konstanten för det första ferroelektriska lagret (12) har ett maximum vid en temperatur som skiljer sig ifrån den temperatur vid vilken den dielektriska konstanten för det andra ferroelektriska lagret (4) har ett maximum.



## PRV Patent använder följande dokumentkoder för sina patentskrifter

kod	klartest		·		
		kod	klartext		
A B B5 C C1 C2 C3 C5 C8 E	allmänt tillgänglig patentansökan utläggningsskrift * rättad utläggningsskrift * patentskrift * patentskrift * patentskrift rättad patentskrift rättad patentskrift korrigerad förstasida till patentskrift patentskrift i ändrad lydelse	L T1 T2 T3 T4 T5 T8 T9	allmånt tillgånglig översättning av kraven i europeisk patentansökan rättelse av översättning av kraven i europeisk patentansökan översättning av europeisk patentskrift översättning av europeisk patentskrift i ändrad avfattning rättad översättning av europeisk patentskrift rättad översättning av europeisk patentskrift korrigerad översättning av europeisk patentskrift		
E8	korrigerad förstasida till patentskrift i åndrad lydelse				
E9	råttad patentskrift i ändrad lydelse	publicerad under äldre lagstiftning			

# Nationskoder

ΑР	African Regional	CN	Kina	KI	Kiribati	RU	Ryska Federationen
	Industrial Property	co	Colombia	KM	Comorema	RW	
	Organization (ARJPO)	CR	Costa Rica	KN	St Kitts	SA	Saudi-Arabien
EA	Euroasian Patent Office	CU	Kuba	KP	Dem. Folkrepubliken Korea	SB	Salomonōarna
	(EAPO)	CV	Kap Verde	KR	Republiken Korea	SC	Seychellerna
EP	Europeiska Patentverket	CY	Cypern	KW	Kuwait	SD	Sudan
	(EPO)	CZ	Tjeckiska republiken	KY	Cayman-ōarna	SE	Sverige
OA	African Intellectual	DE	Tyskland	KZ	Kazachstan	SG	Singapore
	Property Organization	DJ	Djibouti	LA	Laos	SH	St Helena
	(OAPI)	DK	Danmark	LB	Libanon	SI	Slovenien
wo	World Intellectual	DM	Dominica	LC	Saint Lucia	SK	Slovakien
	Property Organization	DO	Dominikanska republiken	LI	Liechtenstein	SL	Sierra Leone
	(WIPO)	DZ	Algeriet	LK	Sri Lanka	SM	
IB	WIPO (i vissa fall)	EC	Ecuador	LR	Liberia	SN	Senegal
		EE	Estland	LS	Lesotho	SO	Somalia
AD	Andorra	EG	Egypten	LT	Litauen	SR	Surinam
ΑE	Förenade Arabemiraten	ES	Spanien	LU	Luxembourg	ST	São Thomé
AF	Afghanistan	ET	Etiopien	LV	Lettland	SV	El Salvador
AG	Antigua	FI	Finland	LY	Libyen	SY	Syrien
AJ	Anguilla	FJ	Fiji-ŏarna		Marocko	SZ	Swaziland
AL	Albanien	FK	Falklandsöarna		Monaco	TD	Tchad
AM	Armenien	FR	Frankrike		Moldavien	TG	Togo
AN	Nederländska Antillema	GA	Gabon		Madagaskar	TH	Thailand
AO	Angola	GB	Storbritannien		Makedonien	TJ	Tadziikistan
AR	Argentina	GD	Grenada		Mali	TM	•
ΑT	Österrike	GE	Georgien		Mayanmar	TN	Tunisien
AU	Australien	GH	•		Mongoliet	TO	Tonga
AZ	Azerbajdzjan	GI	Gibraltar	MR	Mauretanien	TR	Turkiet
BA	Bosnien och	GM	Gambia	MS	Monsterrat	TT	Trinidad och Tobago
	Hercegovina	GN	Guinea	MT	Malta	TV	Tuvalu
BB	Barbados	GO	Ekvatorial Guinea		Mauritius	TW	Taiwan
BD	Bangladesh .	GR	Grekland		Maldiverna	TZ	Tanzania
BE	Belgien	GT	Guatemala		Malawi		Ukraina
BF	Burkina Faso	GW	Guinea-Bissau		Mexiko		
BG	Bulgarien	GY	Guyana		Malaysia	US	Uganda
BH	Bahrain		Hongkong		Mocambique	UY	Förenta Staterna (USA)
Bi	Burundi	HN	Honduras		Namibia	UŽ	Uruguay
BJ	Benin	HR	Kroatien		Nigeria		Uzbekistan
ВМ	Bermuda	нт	Haiti	NI	Nicaragua	VA VC	Vatikanstaten
ВО	Bolivia	HU	Ungern	NL.	Nederländerna	-	St Vincent
BR	Brasilien	ID	Indonesien				Venezuela
BS	Bahamadama	ΙE	Irland	NP	Norge Nepal	VG	Jungfruðarna
BT	Bhutan	IL.	Israel	NR	Nauru		Viet Nam
BW	Botswana	IN	Indien	NZ NZ		VU	Vanuatu
BY	Vitryssland	·IO	Irak		Nya Zeeland Oman	WS	Samoa
BZ		IR	Iran	PA	Oman Panama	YD	Syd-Jemen
CA		IS	Island			YE	Jemen
CF		П	Italien	PE	Peru New Code	YU	Yugoslavien
٠.	Republiken	JМ	Jamaica	PG	Papua Nya Guinea	ZA	Sydafrika
CG	Kongo	10 wr	Jamaica Jordanien	PH	Filippinerna		Zambia
	Schweiz	JD.		PK	Pakistan	ZR	Zaire
CI	Elfenbenskusten		Japan	PL	Polen	ZW	Zimbabwe
	Chile	KE	Kenya	PT	Portugal		
_	Kamerun	KG	Kirgistan	PY	Paraguay		
CIM	Vericinii	КН	Kambodja	RO	Rumānien		
		_					

UPPFINNINGENS OMRÅDE

Föreliggande uppfinning relaterar till det tekniska området elektriskt avstämbara anordningar, exempelvis för mikrovågs(radiofrekvens)-kretsar. Speciellt relaterar den till den till en tunnfilms ferroelektrisk varaktoranordning, användning av en sådan användning i mikrovågs(eller millimetervågs)-kretsar, och till ett förfarande för att framställa en sådan anordning.

#### 15 TEKNIKENS STÅNDPUNKT

Den senaste tiden har åtskilliga avstämbara anordningar avsedda för användning i mikrovågs-, och millimetervågsanordningar föreslagits. En varaktor är en variabel kapacitansanordning vars kapacitans beror på den spänning som appliceras. Varaktorer kända för att användas i RF-avstämningstillämpningar, bland annat beroende på det faktum att kapacitansvariationer hos varaktorn orsakade av en applicerad spänning får motsvarande effekter på frekvensavstämningen.

Varaktorer baserade på halvledare är kända. Emellertid är sådana anordningar ofördelaktiga i många avseenden. T ex är de behäftade med den nackdelen att de har en låg avstämbarhet (begränsad dynamisk räckvidd) vid mikrovågsfrekvenser, dvs över 10-20 GHz, och mikrovågsförlusterna är också stora. Beroende på de inherenta egenskaperna hos halvledarmaterial är sådana varaktorer känsliga för överhettning och utbränning om de förspännes framåt eller förspännes bakåt med en alltför stor applicerad spänning. Halvledande PN-övergångsanordningar har ett utarmningsområde som

utsätts för en hög elektrisk fältpåkänning, och som en följd därav kan sådana anordningar kollapsa när den pålagda spänningen varieras. Dessutom har halvledarmaterial olika dielektriska konstanter, mellan ca 10-15, dvs låga dielektriska konstanter som begränsar kapacitansen, och detta är mycket ofördelaktigt för ett flertal tillämpningar.

Mikroelektromekaniska varaktorer är också kända. I motsats till halvledarvaraktorer har de ett stort dynamiskt område, eller en hög avstämbarhet, och låga mikrovågsförluster, men avstämningshastigheten är begränsad till tiondelar av mikrosekunder. Därutöver är de känsliga för mekaniska vibrationer, har en kort livstid, och de är inte heller tillförlitliga.

10

15 Varaktorer baserade på ferroelektriska material eller icke-linjära dielektrika är också kända, exempelvis genom US-A-5,472,935. Den huvudsakliga nackdelen med de varaktorer som visas i ovan nämnda vilket också gäller för andra avstämbara mikrovågsanordningar baserade på (bulk) ferroelektrika, är att 20 parametrarna är extremt temperaturberoende, vilket relateras till det inherenta temperaturberoendet hos ferroelektriska material. Detta illustreras i Fig. 1A, Fig. 1B, som visar det extrema temperaturberoendet nära maximum för den dielektriska konstanten för typiska ferroelektriska material, såsom Bariumtitanat (BaTiO3, 25 BTO) och Strontiumtitanat (SrTiO<sub>3</sub>, STO). Beroendet hos den dielektriska konstanten рå applicerat elektriskt (avstämbarheten) är också starkare ju närmare man kommer maximum i dielektrisk konstant, emedan längre bort ifrån dielektrisk konstant blir avstämbarheten låg. T ex är STO ej 30 avstämbart vid rumstemperatur vid förhållandevis lågt applicerat elektriskt fält (E<100kV/cm). Detta betyder att kondensatorer som är baserade på STO inte är avstämbara vid omkring rumstemperatur (dvs de är i själva verket inte några varaktorer). Detta betyder

att en hög temperaturstabilitet endast kan uppnås i kombination med en låg avstämbarhet.

Därutöver bildas ett övergångslager i ytan av det ferroelektriska materialet, i gränsen mellan metallelektroderna, t ex av guld, och det ferroelektriska materialet i varaktorn. Det inre elektriska fältet i detta lager kommer att reducera den dielektriska konstanten hos det ferroelektriska materialet, och som en följd därav kommer det också att reducera känsligheten för applicerade externa DC-fält. Med andra ord reduceras varaktorns avstämbarhet.

Ferroelektriska varaktorer baserade på bulkmaterial är bland annat behäftade med den nackdelen att tjockleken på sådana anordningar begränsar den totala kapacitiva effekten.

15

20

25

30

10

- .5

Det har befunnits vara fördelaktigt att använda tunna ferroelektriska filmer för framställning av avstämbara kondensatorer, eftersom dielektriska den konstanten ferroelektriska filmer blir avstämbar genom variation av spänning som appliceras på filmen. Vid höga frekvenser uppvisar sådana filmer intrinsiskt jämförelsevis låga förluster.

US-A-5 640 042 visar en enkel ferroelektrisk varaktor innefattar ett antal tunna filmskikt. Ett bärarsubstratsskikt anordnat på vilket ett metalliskt, ledande lager är deponerat. Tunnfilmsferroelektrikat är sin tur deponerat på det metalliska, ledande lagret, och ett flertal longitudinellt åtskilda metalliska ledande är anordnade рå tunnfilmsferroelektrikat. Bärarsubstratskiktet, det metalliska ledande skiktet och det tunnfilmsskiktet kan ha matchande gitter så att ferroelektriska de bildar en kristallstruktur. matchad Även höare kapacitansvärden än för exempelvis halvledarvaraktorer kan erhållas, som resulterar i en högre avstämbarhet, kommer sådana

anordningar inte att fungera tillfredsställande för ett flertal implementeringar, t ex beroende på att temperaturstabiliteten inte är tillräckligt bra, och den omfattning i vilken en sådan anordning kan avstämmas, inte blir tillräcklig.

### REDOGÖRELSE FÖR UPPFINNINGEN

- •5

10

15

20

25

Vad som behövs är därför en förbättrad varaktoranordning. Mera speciellt behövs en varaktoranordning som har en stor dynamisk räckvidd (ett stort avstämbarhetsområde), och som på samma gång är mycket temperaturoberoende, dvs som uppvisar en hög grad av temperaturstabilitet. Speciellt behövs en ferroelektrisk varaktoranordning som är tillförlitlig, har en lång livstid, och som inte är känslig för mekaniska spänningar eller vibrationer eller liknande. Dessutom behövs en varaktoranordning som har en hög avstämningshastighet. Avstämningshastigheten kan definieras som dC/dt, dvs tids-(t)derivatan av kapacitansen (C), och den visar hur snabbt kapacitansen kan avstämmas. Dessutom behövs en ferroelektrisk varaktoranordning som är lätt att framställa, och som dessutom inte är dyr att framställa. Dessutom behövs en varaktoranordning som lämpar sig för ett stort antal tillämpningar, speciellt för mikrovågseller millimetervågstillämpningar, eller ännu mera speciellt för mikrovågsradiofrekvens-applikationer. Speciellt behövs varaktoranordning som har en hög avstämbarhet (stor dynamisk räckvidd), och som är temperaturoberoende i ett givet temperaturintervall.

Ett förfarande för att producera en sådan varaktoranordning, som uppfyller ett eller flera av de ovan nämnda målen, behövs också, där sagda förfarande speciellt är lätt att implementera. Ett förfarande för att driva en avstämbar ferroelektrisk varaktoranordning såsom ovan hänvisats till behövs också.

Därför tillhandahålles en tunnfilms-ferroelektrisk varaktoranordning innefattar som ett substratlager, ferroelektrisk lagerstruktur och en elektrodstruktur, där den ferroelektriska lagerstrukturen innefattar ett antal ferroelektriska lager och ett antal mellanliggande buffertlager •5 anordnade på ett alternerande sätt. Åtminstone ett första och ett andra av sagda ferroelektriska lager, mellan vilka mellanliggande buffertlager, som kan vara dielektriskt, är har olika Curie-temperaturer. Curie-temperaturen är anordnat, 10 speciellt definierad som en temperatur som kännetecknar temperaturberoendet hos den dielektriska konstanten. Specifikt är det en temperatur för vilken den dielektriska konstanten har ett maximum. Enligt uppfinningen åtstadkommes olika Curie-temperaturer för de respektive ferroelektriska lagren genom att man ger de ferroelektriska lagren olika kemisk sammansättning, eller genom 15 att kemiskt isolera de ferroelektriska lagren ifrån varandra så att olika Curie-temperaturer erhålles. Innehållet i åtminstone ett element i elementsammansättningen av respektive lager är olika i de åtminstone två lagren. (Speciellt kan innehållet av ett element 20 vara noll i ett av lagren.)

Fördelaktigt har åtminstone några av lagren i varaktoranordningen gittermatchade kristallstrukturer. Ännu mera speciellt har alla lager, dvs de lager som ingår i den ferroelektriska lagerstrukturen, elektrodstrukturen, och substratlagret, gittermatchade kristallstrukturer.

25

I en föredragen implementering består lagren, speciellt de mellanliggande buffertlagren och de ferroelektriska lagren och 30 substratlagret, av enkristallina filmer (epitaxiella filmer).

I en föredragen implementering innefattar de ferroelektriska lagren ett keramiskt material. Speciellt föreligger åtminstone ett element eller en komponent av det keramiska materialet i olika mängd för ett antal lager, eller speciellt för alla lager, så att åtminstone näraliggande ferroelektriska lager, där näraliggande skall avse ferroelektriska lager mellan vilka ett mellanliggande buffertlager, speciellt ett dielektriskt buffertlager, är anordnat, innehåller olika fraktioner av sagda element.

I en fördelaktig implementering består de keramiska materialen av perovskitska oxider eller fasta lösningar därav, ABCO₃, där A exempelvis är endera av Ba, Na; B är endera av t ex Sr, Kr; C är endera av Tc, Nb osv. I en speciell implementering innefattar de ferroelektriska lagren Ba<sub>x</sub>Sr<sub>1-x</sub>TiO₃. Åtminstone för ovan nämnda första och andra lager är barium (Ba)-innehållet olika, således är för ett första och ett andra lager elementsammansättningen Ba<sub>x1</sub>Sr<sub>1-x1</sub>TiO₃ respektive Ba<sub>x2</sub>Sr<sub>1-x2</sub>TiO₃, vilket resulterar i olika Curie-temperaturer. Givetvis kan det finnas fler än två lager som har olika xi-värden, speciellt olika bariuminnehåll. Speciellt är för varje ferroelektriskt lager i, 0 ≤ xi ≤ 1.

I en alternativ implementering innehåller de åtminstone två lagren Na<sub>xi</sub>K<sub>1-xi</sub>NbO<sub>3</sub>, där xi är olika för åtminstone två "näraliggande" ferroelektriska lager. I en speciellt fördelaktig implementering består de mellanliggande buffertlagren av dielektriska filmer. De dielektriska filmerna mellan olika ferroelektriska lager kan ha samma elementsammansättning eller olika elementsammansättningar.

I en speciell implementering har åtminstone en av de dielektriska filmerna en elementsammansättning som är MgO, LaAlO<sub>3</sub>, CeO<sub>2</sub> eller ett material med liknande egenskaper. Om den ferroelektriska strukturen är sådan att det finns fler än ett mellanliggande bufferlager, om det t ex finns fler än två ferroelektriska lager som kräver ett mellanliggande buffertlager därmellan, eller om ett mellanliggande lager också är anordnat mellan ett ferroelektriskt

30

lager och substratlagret, kan varje dielektriskt buffertlager ha samma elementsammansättning, med det behöver inte vara så. I en speciellt fördelaktig implementering har åtminstone ett av de dielektriska mellanliggande buffertlagren en elementsammansättning bestående av  $WO_3$ .

. •5

Enligt olika implementeringar har ett dielektriskt elementsammansättningen WO3, medan ett eller flera andra lager består av MgO eller liknande; alternativt består alla lager av  $WO_3$ . I återigen en annan implementering innefattar åtminstone ett 10 av de mellanliggande buffertlagren en flerlagerstruktur innefattar ett antal dellager, där åtminstone ett av sagda dellager har en elementsammansättning bestående av MgO eller liknande, såsom hänvisats till ovan, och åtminstone ett av dellagren har en elementsammansättning WO3. Substratlagret kan bestå 15 av elementsammansättningen MgO, LaAlO3, eller ett material med liknande egenskaper, medan elektrodstrukturen kan bestå longitudinellt anordnade elektroder som definierar däremellan. Elektroderna kan exempelvis bestå av guld (Au), koppar (Cu), silver (Ag) eller liknande, men de kan också bestå av 20 supraledare, eller speciellt högtemperatursupraledare, av YBCO (YbaCuO) eller TBCCO (TlBaCaCuO).

I en fördelaktig implementering har de ferroelektriska lagren en tjocklek som är mindre än, eller lika med, lµm. De mellanliggande buffertlagren, som speciellt är dielektriska, kan ha en tjocklek på 100nm eller mindre. De kan också vara något tjockare om de består av en kombination av WO3 och MgO (också då kan de emellertid vara så tunna som refererats till ovan), eller liknande, eller om de består av en flerlagerstruktur. I en annan implementering innefattar den ferroelektriska lagerstrukturen en ferroelektrisk nanostruktur med ultratunna ferroelektriska lager som har en tjocklek som väsentligen är mindre än eller lika med

100nm. Ett buffertlager kan vara anordnat intill elektrodstrukturen, dvs mellan elektroderna och ett ferroelektriskt lager eller ett mellanliggande buffertlager (ett dielektriskt lager). Ett sådant buffertlager kan exempelvis bestå av tunna metalliska Mg-filmer.

Den ferroelektriska anordningen kan speciellt innefatta en ferroelektrisk lagerstruktur som innefattar tre eller flera ferroelektriska lager, där emellan varje par av ferroelektriska lager ett företrädesvis dielektriskt, mellanliggande buffertlager är anordnat. Ett mellanliggande buffertlager kan också vara anordnat mellan substratlagret och det ferroelektriska lagret som skall deponeras på substratlagret.

•5

- Speciellt kan temperaturberoendet hos kapacitansen för varaktorn styras genom val av Curie-temperaturerna/xi-värdena i elementsammansättningarna av respektive ferroelektriska lager, dvs innehållet av åtminstone ett element i elementsammansättningen.
- En tunnfilms ferroelektrisk varaktoranordning som innefattar ett 20 substratlager, ferroelektrisk en lagerstruktur en elektrodstruktur tillhandahålles, där den ferroelektriska lagerstrukturen innefattar ett antal ferroelektriska lager och ett antal mellanliggande buffertlager, som företrädesvis dielektriska, där de ferroelektriska lagren och de dielektriska 25 anordnade på ett alternerande lagren är sätt, så ferroelektriska lagren, mellan vilka ett mellanliggande buffertlager är anordnat, blir kemiskt separerade ifrån varandra. Atminstone några av de ferroelektriska lagren har 30 elementsammansättning. Speciellt innefattar de ferroelektriska lagren keramiska material, såsom perovskitska oxider eller fasta lösningar av typen  $A_{xi}B_{1-xi}CO_3$ , där xi är olika för åtminstone några på varandra följande ferroelektriska lager mellan vilka ett

mellanliggande buffertlager är anordnat. Speciellt är för varje lager i  $0 \le xi \le 1$ . Speciellt består de ferroelektriska lagren i, där i,...,N; där N är antalet ferroelektriska lager i strukturen, av  $Ba_{xi}Sr_{1-xi}$  TiO<sub>3</sub> eller  $Na_{xi}$   $K_{1-xi}$  NbO<sub>3</sub>. Speciellt har alla lager i varaktoranordningen matchande kristallstrukturer, och Curietemperaturerna för respektive ferroelektriska lager är olika, där de respektive Curie-temperaturerna ges av valet av varje xi, och där valet är gjort på ett sådant sätt att man ska säkerställa att maximumvärdena för de dielektriska konstanterna i respektive lager blir olika. Speciellt kan temperaturberoendet hos varaktorns kapacitans styras. Speciellt är Ba-innehållet/Na-innehållet olika för varje respektive lager (vilket får som en följd att också Sr/K-innehållet blir olika).

\*5

10

- Enligt uppfinningen kan varaktoranordningarna som diskuterats ovan med fördel användas i mikrovågs-(radiofrekvens)kretsar, såsom avstämbara resonatorer, filter, fasskiftare, fördröjningsledare, blandare, harmoniska generatorer eller liknande.
- 20 Ett förfarande för att ' framställa en ferroelektrisk tunnfilmsvaraktoranordning innefattande en substratlagerstruktur, en ferroelektrisk lagerstruktur och en elektrodstruktur anges också, som inkluderar stegen att; anordna en ferroelektrisk lagerstruktur på substratlagerstrukturen, inkluderande stegen att; 25 anordna ett mellanliggande, företrädesvis dielektriskt, buffertlager mellan vardera av ett antal ferroelektriska lager; för åtminstone två ferroelektriska lager (i;i+1), välja olika innehåll (xi,x(i+1))av första en komponent elementsammansättningarna för lagren; välja innehållen (xi,x(i+1)), så att de dielektriska konstanterna för olika lager 30 får olika Curie-temperaturer. Varaktorn kan då få arbeta mellan Curie-temperaturerna för de två ferroelektriska lagren.

## KORTFATTAD FIGURBESKRIVNING

· · ·5

Uppfinningen kommer i det följande att ytterligare beskrivas på ett icke begränsande sätt, och under hänvisning till bifogade figurer, i vilka:

- Fig. 1A är en kurva som visar temperaturberoendet hos BTO,
- Fig. 1B är en kurva som visar temperaturberoendet hos STO,
- 10 Fig. 2 är en tvärsnittsvy av en varaktoranordning enligt ett första utförande av föreliggande uppfinning,
- Fig. 3 är en kurva som illustrerar hur en väsentligen temperaturoberoende kapacitans kan erhållas genom att styra Ba-innehållet för två ferroelektriska lager bestående av BSTO,
- Fig. 4 är en kurva som illustrerar den experimentella verifikationen av temperaturberoendet hos kapacitansen
  C och en kvalitetsfaktor Q för en uppfinningsmässig varaktor,
- Fig. 5 är en vy i tvärsnitt av en varaktoranordning enligt ett andra utförande av föreliggande uppfinning liknande den i Fig. 2, men där ett ytterligare mellanliggande buffertlager är anordnat mellan substratlagret och ett ferroelektriskt lager,
- Fig. 6 är en tvärsnittsvy av en varaktoranordning, enligt ett

  30 tredje utförande av föreliggande uppfinning, som
  innefattar tre ferroelektriska lager och tre
  dielektriska lager, där ett av de dielektriska lagren

har en kemisk sammansättning som skiljer sig ifrån den hos de två övriga,

- Fig. 7 är en tvärsnittsvy av ett fjärde utförande av en varaktor enligt föreliggande uppfinning, där ett av de mellanliggande buffertlagren består av en flerlagerstruktur,
- Fig. 8A är en tvärsnittsvy av ett en-pols avstämbart

  bandpassfilter med en "flip-chip" ansluten varaktor
  enligt uppfinningen,
  - Fig. 8B är en vy ovanifrån av filtret i Fig. 8A, och
- 15 Fig. 9 schematiskt illustrerar en tillämpning av ett avstämbart en-pols bandpassfilter med en varaktor som är ansluten med en bondningsledare ("bond-wire") enligt föreliggande uppfinning.

## 20 DETALJERAD BESKRIVNING AV UPPFINNINGEN

Figurerna 1A respektive 1B visar de extrema temperaturberoendena nära maximum i dielektrisk konstant för strontiumtitanat (SrTiO<sub>3</sub>; STO)(Fig. 1B) och bariumtitanat (BaTiO<sub>3</sub>; BTO)(Fig. 1A). Den dielektriska konstanten visar ett beroende på applicerat DC-fält som är starkare nära maximum i dielektrisk konstant, emedan det minskar längre bort ifrån maximat i dielektrisk konstant. Detta betyder att avstämbarheten skulle bli hög där den dielektriska konstanten har ett maximum, medan längre bort ifrån maximat, skulle avstämbarheten bli låg. Såsom hänvisats till tidigare är STO inte avstämbart vid rumstemperatur vid förhållandevis låga applicerade dielektriska fält. Fig. 1B illustrerar beroendet hos dielektrisk konstant (inversen på den dielektriska konstanten) på temperaturen ovanför Curie-temperaturen TCR, dvs T>TCR. Detta

beroende anges av Curie-Weiss lag;  $\epsilon$  = 78.300/(T-T<sub>CR</sub>). För SrTiO<sub>3</sub> är T<sub>CR</sub> = 28 °K. För T<sub>CR</sub>=381K.

- Curietemperaturen definieras som en temperatur som kännetecknar temperaturberoendet hos den dielektriska konstanten. (Fig. 1B visar  $\varepsilon = 78.300/(T-T_{CR})$ , där  $T_{CR} = 28$ K, för STO.)  $T_{CR}$ , eller snarare den temperatur där den dielektriska konstanten har sitt maximum, kan styras av trycket i ett begränsat temperturområde.
- Det mest effektiva sättet att stämma av  $T_{CR}$  i ett brett temperaturområde utförs enligt uppfinningen genom att förändra innehållet i en komponent i ett material som innehåller en kemisk sammansättning såsom ABCO $_3$ , dvs innehållet av Ba, Na eller något annat lämpligt material.

15

Enligt uppfinningen visas ferroelektriska varaktorer som har en hög avstämbarhet eller ett högt dynamiskt område, vilket betyder ett stort avstämningsområde. Avstämbarheten definieras som T(V) = [C(0)-C(V)] / C(0), där V är den spänning som appliceras på varaktorns DC-fält, C(0) är varaktorns kapacitans vid V=0, medan C(V) är varaktorns kapacitans vid  $V=V_{max}$ , som är den maximala pålagda spänningen.

- Varaktorerna enligt uppfinningen visar en hög avstämbarhet och är 25 väsentligen temperaturoberoende i ett givet temperaturområde (mellan Curie-temperaturerna för de dielektriska konstanterna i respektive ferroelektriska lager).
- I Fig. 2 visas en varaktoranordning 10 enligt ett första utförande. Den innefattar ett substratlager 1 som innehåller ett kristallint dielektrikum, med låga mikrovågsförluster exempelvis av MgO, LaAlO<sub>3</sub> eller ett liknande material, dvs ett material med liknande egenskaper. På substratlagret 1 deponeras den

ferroelektriska lagerstrukturen 12, som här innefattar ett första ferroelektriskt lager 2, ett mellanliggande buffertlager 3, som företrädesvis är dielektriskt, och ett andra ferroelektriskt lager 4.

·5

10

15

20

Det första ferroelektriska lagret 2 är deponerat på substratlager 1. De ferroelektriska lagren 2, 4 innefattar keramiska material, t ex oxider av perovskittyp eller en lösning därav, av typ  $A_xB_{1-x}CO_3$ , där A = Ba, Na osv, B = Sr, K osv, C = Ti, Nb eller liknande. Vilket sådant material som helst kan i princip användas så länge som mikrovågsförlusterna är låga. I speciella utföranden innefattar de keramiska materialen  $Ba_{xi}Sr_{1-xi}TO_3$  eller  $Na_{xi}K_{1-xi}NbO_3$ , där xi är valt att vara olika för de respektive lagren 2, 4 så att olika Curie-temperaturer erhålles. xi är sådant att 0  $\leq$  xi  $\leq$ Detta betyder speciellt att för  $Ba_xSr_{1-x}TiO_3$  kommer extremfall att uppträda, nämligen när xi = 0 kommer det att vara SrTiO<sub>3</sub>, medan for x = 1 kommer det att bli BaTiO<sub>3</sub>. I fallet av  $Na_{xi}K_{1-xi}NbO_3$  kommer det också att bli två extremfall, nämligen för xi = 0, kommer det att bli  $KNbO_3$  medan för x = 1,  $kommer \ det \ att \ bli \ NaNbO_3. \ I \ allmänhet \ kan \ xi \ vara \ vilket \ värde$ som helst mellan 0 och 1, inkluderande 0 och 1.

I detta utförande antas att det första ferroelektriska lagret 2 består av  $Ba_{xi}Sr_{1-xi}TiO_3$ , där xi är ett valt värde x1, och detta lager är deponerat på substratlagret 25 1. Ett dielektriskt filmlager 3, t ex av MgO, LaAlO $_3$ , CeO $_2$  eller liknande är deponerat på det ferroelektriska lagret. På det dielektriska lagret 3 är ett andra ferroelektriskt lager 4 deponerat, vilket innefattar en annan ferroelektrisk film, exempelvis  $Ba_{x2}Sr_{1-x2}TiO_3$ , där x2 valts 30 ett värde som skiljer sig ifrån värdet Substratlagret 1 och lagren i den ferroelektriska strukturen, dvs lagren 2, 3, 4, har matchande kristallstrukturer, bland annat för att förhindra mekaniska spänningar i filmerna. Matchande

kristallstrukturer avser här att de två angränsande kristallerna (substrat-ferroelektriskt lager, ferroelektriskt lager-dielektriskt lager, eller substrat-dielektriskt lager) ska ha kristallina strukturer och gitterkonstanter som är så nära varandra som möjligt.

I varaktoranordningen 10 i Fig. 2 styrs Curie-värdena för de ferroelektriska Barium-Strontium-Titanate (BSTO)-filmerna Bariuminnehållet, dvs av xi-faktorerna x1 och x2 såsom 10 diskuterats ovan. De två ferroelektriska lagren med Bariuminnehåll isoleras kemiskt ifrån varandra genom närvaron av dielektriska lagret 3. Ι en synnerligen fördelaktig implementering (relevant för utförandet i Fig. 2 och alla andra utföranden som kommer att beskrivas nedan), är alla epitaxiella, dvs enkristallina för att 15 säkerställa en dielektrisk konstant, en höq avstämbarhet och låga mikrovågsförluster. Det mellanliggande buffertlagret 3. företrädesvis är en dielektrisk film, används speciellt för att säkerställa en kemisk isolering mellan de två BSTO-filmerna med olika xi-värden, dvs för att förhindra bildandet av en ny fas av 20 BSTO med ett x-värde mellan x1 och x2, och härav med ett annorlunda Curie-värde (maximum i dielektrisk konstant), jämför de två topparna i dielektrisk konstant för x1 respektive x2 såsom i Fig. 3. Med andra ord är avsikten med det dielektriska filmlagret 3 att säkerställa distinkt olika egenskaper 25 belägenheter för (temperatur)-topparna i dielektrisk konstant för det första ferroelektriska lagret 2 och det andra ferroelektriska lagret 4. Företrädesvis, såsom hänvisats till ovan, ligger xivärdena mellan 0 och 1. Det mellanliggande buffertlagret 3 används också för att säkerställa en hög kristallin kvalitet hos 30 ferroelektriska lagret 4. Ferroelektriska lager vanligtvis en god kristallin kvalitet om tjockleken på filmlagret är liten, speciellt mindre än  $1\mu m$ . Försök att växa tjockare

epitaxiella filmer leder till en försämring av kristallstrukturen (beroende på att defekter uppstår) och av de dielektriska egenskaperna. Applicering av tunna, vanligtvis mindre än 100 nm, mellanliggande buffertlager med gittermatchade dielektriska lager, av exempelvis MgO, LaAlO $_3$ , CeO $_2$  eller liknande, såsom hänvisats till ovan, bidrar till att bevara den kristallina strukturen för det ferroelektriska lagret 4 i den ferroelektriska strukturen. Eftersom tjockleken рå det mellanliggande (dielektriska) buffertlagret 3 är liten, påverkar det i praktiken knappast varaktorns kapacitans och avstämbarheten.

Såsom kommer att diskuteras ytterligare nedan, är det möjligt att, istället för att använda en epitaxiell ferrroelektrisk trelagersstruktur såsom visat i utförandet i Fig. 2, göra varaktorer som består av ferroelektrisk flerlagerstruktur, exempelvis med ferroelektriska lager av BSTO och ett dielektrika av MgO, med en lägre kapacitans (som kan vara önskvärt ibland) och lägre mikrovågsförluster på bekostnad av lägre avstämbarhet. Också andra flerlagerstrukturer är möjliga, av vilka några kommer att visas nedan.

10

Det ferroelektriska lagret 2 och ferroelektriskt lager 4 har olika Barium(Ba)-innehåll, och härav olika Curie-temperaturer T<sub>CR1</sub> och T<sub>CR2</sub> såsom illustrerats i Fig. 3. Maxima i dielektrisk konstant uppträder för olika temperaturer. Curietemperaturerna för de ferroelektriska lagren 2 och 4 (dvs läget för maximum i dielektrisk konstant) väljes genom att man på rätt sätt väljer ut Ba-innehåll för lagren 2, 4, dvs xi-värdena.

30 Detta urval görs lämpligen så att det önskade arbetstemperaturområdet för varaktorn ligger mellan temperaturerna för de ferroelektriska lagren 2 och 4, jämför Fig. 2. Kapacitansen mätt mellan de två elektroderna  $9_1$ ,  $9_2$  kommer då

att få ett nästan temperaturoberoende värde som kan ses i Fig. 3. Avstämbarheten för en sådan varaktor kommer att, beroende på de överlappande "svansarna" i dielektrisk konstant för lagren 2 och 4, att bli större än för en varaktor som bara är baserad på exempelvis lager 2 eller lager 4 inom samma temperaturområde.

-5

15

20

Därutöver blir det, genom att på lämpligt sätt Ba-dopa de ferroelektriska lagren, dvs genom lämpligt val av x-värdena, möjligt att välja tecken  ${\tt temperaturkoefficienten}$ рå 10 kapacitansen (TCC) i ett . givet temperaturområde. Temperaturkoefficienten för kapacitansen ges enligt TCC = [C(T1)-C(T2)] /C(T1); där C(T1) och C(T2) är kapacitansen vid T1 respektive T2. I Fig. 3 är TCC negativ i området ifrån  $T_{\text{CR1}}$ till N, positiv i området mellan P till  $T_{\text{CR2}}$ , och ungefärligen 0 mellan N och P.

en ferroelektrisk-dielektrisk flerlagerstruktur kan bestå av flera lager av ferroelektriskt material med olika xi:n, dvs med olika innehåll av exempelvis A-komponenten, t ex Ba eller Na, och olika Curie-temperaturer. Detta ger ett medel för att ännu mera noggrant kunna skräddarsy temperaturberoendet varaktorns kapacitans.

I ett utförande, ej visat, består den ferroelektriska strukturen 25 flerlagerstruktur en som innefattar en ferroelektrisk nanostruktur som innehåller en periodisk stack i ultratunna ferroelektriska lager, som har en tjocklek på mindre än 100 nm, och dielektriska lager, vilka är anordnade på ett alternerande sätt. En flerlagerstruktur kan exempelvis bestå av fler än två lager med en total tjocklek på omkring 0.5  $\mu m$ . Sådana 30 strukturer får utvidgade icke-linjära egenskaper och elektriska fält, och således kan en hög avstämbarhet uppnås också vid applicering av låga spänningar.

I det utförande som illustreras i Fig. 2 är buffertlager  $8_1$ ,  $8_2$ anordnade mellan elektroderna  $9_1$ ,  $9_2$  och den ferroelektriska filmen. Ändamålet med dessa är att eliminera övergångslager i gränsen såsom diskuterats tidigare i ansökan. Buffertlagren  $8_1$ ,  $8_2$ kan exempelvis innehålla metallisk magnesium. I en speciell implementering består elektroderna  $9_1$ ,  $9_2$  av guldelektroder. Genom användningen av buffertlageren  $8_1$ ,  $8_2$ , bildas ohmska kontakter i gränssnitten mellan ferroelektriskt lager 4 och elektroderna 91,  $9_2$ . Därför kommer inte några inre elektriska fält att utvecklas i de ferroelektriska lagren. 10 Som ett resultat därav kan dielektriska konstanten, vid noll yttre biasering, och avstämbarheten, för varaktorn båda hållas höga. Dessa buffertlager är emellertid inte nödvändiga för fungerandet av föreliggande uppfinning, utan de relaterar endast till fördelaktig implementering. Elektroderna behöver inte heller vara 15 guldelektroder, utan vilket annat lämpligt material som helst kan användas, såsom exempelvis Cu, Ag eller liknande. Dessutom är det möjligt att använda supraledande elektroder, eller ännu mera speciellt högtemperatursupraledande elekroder, t ex (Y-Ba-Cu-O). Därutöver, kan istället för Mg, Ti eller liknande 20 metaller användas för buffertlagren för att ge upphov till ohmska kontakter.

Mikrovågsförlusterna blir minimala i det område där TCC är litet, eller speciellt omkring noll, följaktligen kommer varaktorns kvalitetsfaktor att få ett maxvärde. Detta beror på det faktum att förlusterna i de ferroelektriska lagren 2, 4 blir som högst vid Curie-temperaturerna T<sub>CR1</sub> respektive T<sub>CR2</sub>, och minskar när man avlägsnar sig ifrån dessa temperaturer, såsom kan ses ur det exprimentella prestandat för en varaktoranordning av slaget som diskuterats i Fig. 2, jämför Fig. 4. Denna Fig. 4 relaterar till speciella exprimentella resultat vid utnyttjande av BSTO-filmer som ferroelektriska lager 2 respektive 4. I denna speciella

implementering består det ferroelektriska lagret 2 av BSTO med x1 = 0.75, dvs  $Ba_{0.75}Sr_{0.25}TiO_3$  och har en tjocklek på 0.4  $\mu m$ . Det ferroelektriska lagret 4 består av  $Ba_{0.25}Sr_{0.75}TiO_3$ , och har en tjocklek på 0.4  $\mu m$ .

5

10

Det dielektriska lagret 3 består av MgO, och det har en tjocklek på omkring 0.1  $\mu$ m. Substratlagret 1 består av MgO, och det har en tjocklek på 0.5 mm. Buffertlagren  $8_1$ ,  $8_2$  består av Mg med en tjocklek på 0.1  $\mu$ m. Elektroderna  $9_1$ ,  $9_2$  består av Au, och har en tjocklek på 1.0  $\mu$ m. Storleken på elektroderna  $9_1$ ,  $9_2$  är 0.125  $\times$  0.125 mm, medan bredden på slitsen mellan elektroderna  $9_1$ ,  $9_2$  är 2.5  $\mu$ m. I denna implementering har filmerna växts epitaxiellt med användning av laserablation. Elektroderna är framställda genom vakuumförångning följt av fotolitografisk mönstring.

15

20

Det skall vara klart att detta endast relaterar till ett specifikt utförande, och uppfinningen är givetvis inte begränsad till att epitaxiella filmer är framställda på något speciellt sätt, såsom ett exempel kan liknande epitaxiella filmer också vara framställda genom andra lämpliga teknologier för epitaxiell växt, såsom sputtring, kemisk ångdeponering, osv vilket torde vara känt för fackmannen. I flerlagerstrukturer kan alla mellanliggande buffertlager bestå av samma material, men bufferlagren i en varaktoranordning kan också bestå av olika material.

25

30

Som ett alternativ till ett mellanliggande buffertlager bestående av MgO, jämför lager 3 i Fig. 2, eller ett material av liknande slag, kan också andra (kristallmatchade) material användas. Ett exempel är  $WO_3$ . Detta är en oxid som har som egenskap att kunna attrahera syre och anrika ferroelektriska lager med syre. Framställning av ferroelektriska lager eller filmer med ett önskat innehåll av syre är svårt. Vanligtvis råder det brist på

syre i ferroelektriska filmer, vilket negativt påverkar de dielektriska egenskaperna för en ferroelektrisk kristall. Således kan de dielektriska egenskaperna ytterligare förbättras genom användning av  $WO_3$  istället för MgO. Detta är givetvis tillämpligt för varje utförande som täcks av föreliggande uppfinning.

Fig. 5 visar en annan varaktoranordning 20 enligt uppfinningen, innefattar substratlager 1A och en ferroelektrisk ett struktur 12A anordnad på substratlagret 1A. Den ferroelektriska strukturen 12A består av ett första ferroelektriskt lager 2A och andra ferroelektriska lager 4A, mellan vilka mellanliggande buffertlager 5A är anordnat. Därutöver innefattar ytterligare mellanliggande buffertlager 3A anslutning till substratlagret 1A, dvs substratlagret 1A och det första ferroelektriska lagret 2A. Såsom utförandet beskrivet under hänvisning till Fig. buffertlager  $8A_1$ ,  $8A_2$  anordnade mellan det översta ferroelektriska lagret 4A och de longitudinella elektroderna  $9A_1$ ,  $9A_2$ , mellan vilka elektroder ett gap 11A definieras. De material som används i detta utförande kan vara vilka som helst av de material som diskuterats tidigare i ansökan, i generella termer ABCO3, de mellanliggande buffertlagren kan också vara av de slag som diskuterats ovan, t ex dielektriska lager exempelvis av MgO eller  $\mathrm{WO}_3$  eller vilken kombination som helst därav.

25

30

10

15

20

I en speciell implementering består de dielektriska lagren 3A, 5A av olika material. I en implementering består ett av lagren exempelvis av MgO, eller ett material med liknande egenskaper, medan det andra består av WO<sub>3</sub>. Utöver de egenskaper som diskuterats ovan kan de mellanliggande buffertlagren, t ex de dielektriska lagren, användas för att styra spänningen (tryck eller drag) i de ferroelektriska lagren beroende på vilka deras gitterkonstanter är i förhållande till gitterkonstanten för de

angränsande dielektriska lagren. Om exempelvis det ferroelektriska lagret behöver tryckas ihop, skulle gitterkonstanten i det dielektriska lagret vara mindre gitterkonstanten för ferroelektrikat, i det att man fortfarande iakttar kristallmatchning, och vice versa om det ferroelektriska lagret behöver sträckas.

Fig. visas återigen ett annat utförande varaktoranordning 30 enligt uppfinningen. Liksom i föregående utföranden består den av ett substratlager 1B på vilket en 10 ferroelektrisk lagerstruktur 12B är anordnad. Ovanpå ferroelektriska lagerstrukturen 12B är elektroder anordnade, och det finns ett gap 11B emellan dem. Företrädesvis är tunna buffertlager  $8B_1$ ,  $8B_2$  anordnade mellan elektroderna och 15 angränsande ferroelektriska lager i den ferroelektriska strukturen 12B. I detta utförande består den ferroelektriska strukturen 12B av tre ferroelektriska lager 2B, 4B, 6B och tre mellanliggande buffertlager 3B, 5B, 7B som företrädesvis är dielektriska. De dielektriska lagren och de ferroelektriska lagren är anordnade på ett alternerande sätt. I ett alternativt 20 utförande (ej visat) finns det inte något mellanliggande buffertlager anordnat mellan substratlagret och påföljande ferroelektriska lager. Företrädesvis har de tre ferroelektriska lagren 2B, 4B, 6B olika xi-värden. Alternativt har 25 ferroelektriska lager olika xi-värden, medan det tredie ferroelektriska lagret har samma xi-värde som ett av de andra ferroelektriska lagren. Då måste emellertid det mellanliggande ferroelektriska lagret 4B skilja sig ifrån de ferroelektriska lagren 2B, 6B.

30

I varaktoranordningen 30 kan det dielektriska lagret 5B exempelvis skilja sig kemiskt ifrån de ferroelektriska lagren 3B, 7B, som exempelvis består av MgO för att ta hand om exempelvis spänningar

om lagren 3B, 7B används bara för att attrahera syre, och exempelvis bestå av eller ett material med liknande  $WO_3$ , egenskaper. Givetvis kan också de dielektriska lagren 3B,, 5B, 7B vara likadana. Alternativt kan alla tre vara olika.

5

10

15

25

Fig. visar återigen en annan implementering en varaktoranordning 40 enligt uppfinningen. Angränsande substratlager 1C är en ferroelektrisk struktur 12C anordnad på vilken elektroder  $9C_1$ ,  $9C_2$  är longitudinellt anordnade så att ett longitudinellt gap 11C definieras däremellan. Mellan elektroderna  $9C_{,1}$   $9C_{2}$  är tunna buffertlager  $8C_{1}$ ,  $8C_{2}$  anordnade, vilka emellertid inte är nödvändiga för fungerandet av föreliggande uppfinning. Den ferroelektriska strukturen 12C innefattar tre ferroelektriska lager 2C, 4C, 6C i likhet med utförandet i Fig. 6. Mellan det understa ferroelektriska lagret 2C och substratlagret 1C, är ett första mellanliggande buffertlager 3C anordnat. Mellan det första 2C respektive det andra 4C ferroelektriska lagret, är ett andra mellanliggande buffertlager 5C anordnat, som i detta utförande består av tre dellager  $5C_1$ ,  $5C_2$ ,  $5C_3$  , dvs det mellanliggande 20 buffetlagret 5C består av en kombination av (olika) dielektriska dellager för att ta hand om spänningen (gittermatchningen) och syreanrikningen på en och samma gång. mellanliggande Det buffertlagret 5C kan exempelvis bestå av ett dellager av MgO som är infört mellan två  $WO_3$  lager  $5C_3$ ,  $5C_1$ . Mellan det andra ferroelektriska lagret 4C och det tredje ferroelektriska lagret 6C är ett annat mellanliggande buffertlager 7C anordnat. Det innefattar här ett enda lager.

I ett alternativt utförande kan mellanliggande buffertlager som 30 av ett antal dellager, såsom det mellanliggande buffertlagret 5C, användas mellan alla ferroelektriska lager och/eller mellan substratlagret och påföljande ferroelektriskt

lager osv. Vilken kombination som helst är i princip möjlig. Det kan givetvis också bestå av fler än tre dellager osv.

Det skall vara klart att en varaktoranordning enligt föreliggande uppfinning kan anta många olika former, och den kan varieras på ett antal sätt inom ramen för föreliggande uppfinning. Den är inte begränsad till något speciellt antal lager som skall inkluderas i den ferroelektriska strukturen, olika material kan användas i olika kombinationer, och också substratlagret och elektrodstrukturen kan varieras på ett antal det huvudsakliga är att det finns en ferroelektrisk lagerstruktur som ferroelektriska och (dielektriska) innehåller mellanliggande buffertlager som är anordnade på ett alternerande sätt för att "kemiskt" isolera på varandra följande ferroelektriska lager som har olika Curie-temperaturer, ifrån varandra.

10

15

Figurerna 8A, 8B respektive Fig. 9 illustrerar schematiskt två praktiska implementeringar. Fig. 8A är en tvärsnittsvy av ett enresonator) avstämbart bandpassfilter pols (en mikrostripledare 16D är anordnad på ett substrat 15D, så att 20 18D tillhandahålles. Ovanpå en halv-våglängds kopplingsgap resonator 17D är en varaktoranordning 50 enligt föreliggande uppfinning ansluten genom en så kallad "flip-chip" förbindelse innehåller "bumps"  $13D_{1}$ ,  $13D_2$ som är anslutna elektroderna  $9D_1$ ,  $9D_2$  på varaktoranordningen 50 vilken, liksom i 25 föregående utförande, består av en substratlagerstruktur 1D, en ferroelektrisk lagerstruktur 12D och longitudinellt anordnade 9D<sub>1</sub>,  $9D_2$ , mellan vilka och den ferroelektriska lagerstrukturen 12D, också i detta utförande, tunna buffertlager 30 8D₂ är anordnade. I detta utförande innehåller den ferroelektriska lagerstrukturen 12D två ferroelektriska lager och två mellanliggande dielektriska buffertlager. Det ska vara klart att vilken varaktoranordning som helst som faller inom ramen för

föreliggande uppfinning skulle kunna vara ansluten genom en "flip-chip" förbindelse.

Fig. 8B är en vy ovanifrån av ett bandpassfilter som i Fig. 8A, och det kan ses hur varaktorn 50 är ansluten till en halv våglängds,  $L = \lambda/2$ , -resonator anordnad på substrat 15D. När en DC-biaseringskrets (ej illustrerad av enkelhetsskäl) ansluts till varaktoranordningen, med andra ord när en DC-bias appliceras på varaktorn, kommer kapacitansen hos varaktorn att förändras, och således kommer den totala kapacitansen för resonatorn att förändras liksom dess resonansfrekvens.

9 visar ett alternativt utförande av ett en-pols resonator) avstämbart bandpassfilter 55 med en varaktornanordning 60 ansluten därtill med användning av "bonding wires"  $13E_1$ ,  $13E_2$ . 15 På ett substrat 15E är en mikrostripledare 16E anordnad så att kopplingsgap 18E bildas. Varaktoranordningen 60 via bondningsledare  $13E_1$ ,  $13E_2$  förbunden med elektroderna  $9E_1$ , anslutna till respektive resonatorplattor. Varaktoranordningen 60, illustreras inte i detalj, eftersom vilken som helst av 20 varaktoranordningarna som diskuterats tidigare kan användas, eller vilken annan varaktoranordning som helst som faller inom ramen för föreliggande uppfinning. Mikrovågs-inrespektive utgången illustreras, och inte heller i detta fall visas DCbiaseringskretsen av enkelhetsskäl. En DC-bias som appliceras på 25 varaktorn 60 förändrar dess kapacitans och således den totala kapacitansen för resonatorn 17E, likväl som den förändrar dess resonansfrekvens.

Det skall vara klart att varaktoranordningen kan användas i många andra tillämpningar i olika slag av mikrovågstransmissionsledarapplikationer, filter, resonatorer, slitstransmissionsledare, och generellt i mikrovågs- och millimetervågskretsar,

såsom fasskiftare, fördröjningsledare, blandare, harmoniska generatorer osv.

Det skall också vara klart att elektrodstrukturen inte är begränsad till två longitudinellt anordnade elektroder, utan de kan i princip vara av vilken form som helst och de kan vara anordnade i vilket antal som helst. Även om elektroderna för de flesta av de illustrerade anordningarna är överst och substratet underst, skall det uppfinningsmässiga konceptet inte begräsas därtill.

Också i andra avseenden är uppfinningen inte begränsad till de specifikt illustrerade utföringsexemplen, utan den kan varieras på ett antal sätt inom ramen för vidhängande patentkrav.

15

<sup>-</sup>5

10

20

25

#### PATENTKRAV

- En ferroelektrisk tunnfilms-varaktoranordning (10;20;30;40; 50;60) innefattande ett substratlager (1;1A;1B;1C;1D;1E;1F), en ·5 ferroelektrisk lagerstruktur (12;12A;12B;12C;12D;12E) elektrodstruktur  $(9_1, 9_2; 9A_1, 9A_2; ...; 9E_1, 9E_2)$ , kännetecknad därav att den ferroelektriska lagerstrukturen (12;12A;12B;12C;12D;12E) består av ett antal ferroelektriska lager (2,4;2A,4A;2B,4B,6B; 10 2C, 4C, 6C) och ett antal mellanliggande buffertlager (3;3A,5A;3B,5B,7B;3C,5C,7C) anordnade på ett alternerande sätt, atminstone ett första och ett andra lager har olika Curie-temperaturer, dvs ferroelektriska dielektriska konstanten för det första ferroelektriska lagret har ett maximum vid en temperatur som skiljer sig ifrån temperaturen 15 vilken den dielektriska konstanten för det andra ferroelektriska lagret har ett maximum.
- 2. En varaktoranordning enligt patentkrav 1,
  k ä n n e t e c k n a d d ä r a v
  att åtminstone sagda första och andra ferroelektriska lager
  (2,4;2A,4A;2B,4B,6B;2C,4C,6C) är kemiskt isolerade ifrån varandra
  genom ett mellanliggande buffertlager (3;3A,5A;3B,5B,7B;
  3C,5C,7C), och att den kemiska elementsammansättningen för de
  ferroelektriska lagren (2,4;2A,4A;2B,4B,6B;2C,4C,6C) skiljer sig
  genom att inehållet av åtminstone ett element är olika.
  - 3. En varaktoranordning enligt patentkrav 1 eller 2, kännetecknad därav
- att åtminstone några av substratlagret (1;1A;1B;1C;1D;1E;1F), lagren i den ferroelektriska lagerstrukturen (12;...;12E), och elektrodstrukturen (9<sub>1</sub>,9<sub>2</sub>;...;9E<sub>1</sub>,9E<sub>2</sub>) har matchande kristallstrukturer.

- 4. En varaktoranordning enligt patentkrav 3, k ä n n e t e c k n a d d ä r a v att alla lager har gittermatchade kristallstrukturer.
- 5. En varaktoranordning enligt något av patentkraven 1-4, kännetecknad därav att lagren i den ferroelektriska lagerstrukturen (12;...;12E) består av enkristallina (epitaxiella) filmer.
- 10 6. En varaktoranordning enligt något av föregående patentkrav, kännetecknad där av att de ferroelektriska lagren består av keramiska material.
  - 7. En varaktoranordning enligt patentkrav 6,
- kännetecknad därav att det eller de keramiska materialen består av perovskitska oxider eller fasta lösningar därav, ABCO3, där A är någon av t ex Ba, Na, osv, B är någon av t ex Sr, K, osv, C är någon av Ti, Nb, osv.

20

- En varaktoranordning enligt patentkrav 7,
   k ä n n e t e c k n a d dä r a v
   att varje ferroelektriskt lager (2,4;...;2C,4C,6C) (i) har en respektive elementsammansättning av Ba<sub>xi</sub>Sr<sub>1-xi</sub>TiO<sub>3</sub> , där innehållet
   xi är olika för åtminstone två ferroelektriska lager för att åstadkomma olika Curie-temperatur för sagda åtminstone två ferroelektriska lager.
  - 9. En varaktoranordning enligt patentkrav 7,
- 30 kännetecknad därav att de ferroelektriska lagren (2,4;...,2C,4C,6C) består av  $Na_{xi}K_{1-xi}NbO_3$ , där innehållet xi skiljer sig för åtminstone två

ferroelektriska lager för att ge upphov till olika Curietemperaturer.

- 10. En varaktoranordning enligt patentkrav 8 eller 9,
- 5 kännetecknad därav att för åtminstone två, eller åtminstone sagda första och sagda andra, ferroelektriska lager i, i+1, är 0 ≤ xi ≤ 1;0 ≤ x (i+1) ≤ 1.
- 10 11. En varaktoranordning enligt något av föregående patentkrav, kännetecknad därav att de mellanliggande buffertlagren (3;3A,5A;3B,5B,7B;3C,5C,7C) består av dielektriska filmer.
- 15 12. En varaktoranordning enligt patentkrav 11, kännetecknad därav att åtminstone ett av de dielektriska filmlagren har en elementsammansättning bestående av MgO, LaAlO3, CeO2 eller ett material med liknande egenskaper.
- 13. En varaktoranordning enligt patentkrav 11 eller 12, kännetecknad därav att åtminstone ett av de dielektriska filmlagren består av en elementsammansättning av WO3 eller ett material med liknande
- 25 egenskaper.

20

14. En varaktoranordning enligt något av föregående patentkrav, kännetecknad där av att åtminstone ett av de mellanliggande bufferlagren (5C) består av en multilagerstruktur som består av ett antal dellager (5C<sub>1</sub>,5C<sub>2</sub>,5C<sub>3</sub>), där åtminstone ett dellager består av en elementsammansättning av MgO eller liknande, och åtminstone ett dellager består av en elementsammansättning av WO<sub>3</sub>.

- 15. En varaktoranordning enligt något av föregående patentkrav, kännetecknad där av att substratlagret (1;...;1E) har en elementsammansättning av MgO, LaAlO3 eller ett material med liknande egenskaper, och att elektrodstrukturen består av longitudinellt anordnade elektroder  $(9_1, 9_2;...;9E_1, 9E_2)$  exempelvis av guld, mellan vilka ett gap definieras.
- 16. En varaktoranordning enligt något av föregående patentkrav, 10 k ä n n e t e c k n a d d ä r a v att de ferroelektriska lagren har en tjocklek som väsentligen är ≤ 1 µm, och att de mellanliggande buffertlagren har en tjocklek som väsentligen är ≤ 100 nm.
- 15 17. En varaktoranordning enligt något av föregående patentkrav, kännetecknad där av att den ferroelektriska lagerstrukturen består av en ferroelektrisk nano-struktur med ultratunna ferroelektriska lager som har en tjocklek på ungefärligen ≤ 100 nm.

20 En varaktorano

18. En varaktoranordning enligt något av föregående patentkrav, kännetecknad där av att i anslutning till elektrodstrukturen ett buffertlager  $(8_1,8_2;...;8D_1,8D_2)$  (t ex av tunna metalliska Mg-filmer) är anordnat.

25 -

19. En varaktoranordning enligt något av föregående patentkrav, kännetecknad där av att den ferroelektriska lagerstrukturen (12B;12C) består av tre eller flera ferroelektriska lager.

30

20. En varaktoranordning enligt något av föregående patentkrav, kännetecknad där av

att temperaturberoendet hos varaktorn ges av valet av Curietemperaturer/värden på xi/1-xi för ett element i sammansättningen av respektive ferroelektriska lager.

21. En ferroelektrisk tunnfilms-varaktoranordning (10;20;30;40; 50;60) bestående av ett substratlager (1;1A;1B;1C;1D;1E), en ferroelektrisk lagerstruktur och en elektrodstruktur (91,92;...;9E1,9E2),

kännetecknad därav

- att den ferroelektriska lagerstrukturen (12;...;12E) består av ett antal ferroelektriska lager (2,4;2A,4A;2B,4B,6B;2C,4C,6C) och ett antal mellanliggande buffertlager (3;3A,5A;3B,5B,7B;3C,5C,7C), som företrädesvis är dielektriska, att de ferroelektriska lagren och de dielektriska lagren är anordnade på ett alternerande sätt
- så att ferroelektriska lager mellan vilka ett mellanliggande 15 buffertlager är anordnat är kemiskt separerade ifrån varandra, att de har en olik elementsammansättning, att temperaturberoendet hos den dielektriska konstanten för respektive lager blir olika.

20

22. En ferroelektrisk tunnfilms-varaktoranordning enligt patentkrav 21,

kännetecknad därav

- att de ferroelektriska lagren består av keramiska material, såsom perovskitska oxider eller fasta lösningar av typen  $A_{xi}B_{1-xi}CO_3$ , där xi är olika för åtminstone på varandra följande ferroelektriska lager mellan vilka ett mellanliggande buffertlager är anordnat.
  - 23. En varaktoranordning enligt patentkrav 22,
- 30 kännetecknad därav att för varje ferroelektriskt lager, i; i=1,...N; där N är antalet ferroelektriska lager,  $0 \le xi \le 1$ .

- 24. En varaktoranordning enligt patentkrav 23, kännetecknad därav att de ferroelektriska lagren i, i= 1,...N; där N är antalet lager, består av  $Ba_{xi}Sr_{1-xi}TiO_3$  eller  $Na_{xi}K_{1-xi}NbO_3$ .
- En varaktoranordning enligt patentkrav 23 eller 24, kännetecknad därav att alla lager i varaktoranordningen har matchande kristallstrukturer, och att Curie-temperaturerna för respektive lagren är olika, där Curie-temperaturerna styr värdet 10 på xi, så att temperaturberoendet hos varaktorns kapacitans kan styras.
- 26. Användning av ett antal varaktoranordningar enligt något av föregående patentkrav i avstämbara mikrovågs(RF)kretsar, såsom avstämbara resonatorer, filter, fasskiftare, fördröjningsledare, blandare, harmoniska generatorer eller liknande.
- 27. Ett förfarande för att framställa en ferroelektrisk 20 tunnfilms-varaktoranordning bestående av en substratlagerstruktur, en ferroelektrisk lagerstruktur och en elektrodstruktur,

kännetecknat därav att det innefattar stegen att:

. -5

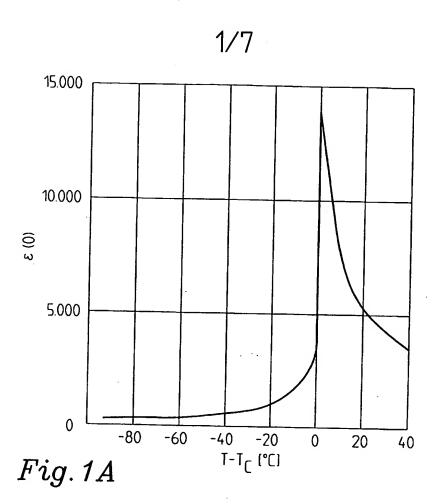
- 25 anordna en ferroelektrisk struktur på substratlagerstrukturen, inkluderande stegen att;
  - anordna ett mellanliggande, företrädesvis dielektriskt, buffertlager mellan vardera av ett antal ferroelektriska lager,
- olika innehåll (xi;x(i+1)) för ett första element i den respektive elementsammansättningen för lagren (i;i+1),

- välja innehållen (xi;x(i+1)) så att de dielektriska konstanterna för de olika lagren får olika Curietemperaturer, så att det önskade arbetstemperaturområdet för varaktorn kommer att ligga mellan Curie-temperaturerna för de två ferroelektriska lagren;
- anordna elektrodstrukturen på den ferroelektriska lagerstrukturen.
- 28. Ett förfarande för att driva en ferroelektrisk avstämbar tunnfilms-varaktoranordning framställd enligt förfarandet i krav 27 med användning av en vakuumdeponeringsmetod, företrädesvis laserablation, för att deponera ett antal tunna filmer för att åstadkomma en kristallmatchad struktur, där sagda film består av ett substratlager, en ferroelektrisk lagerstruktur och en elektrodstruktur.

kännetecknat därav att det innefattar stegen att;

- låta varaktoranordningen arbeta i temperaturintervallet mellan Curie-temperaturerna för de åtminstone två ferroelektiska lagren;
- applicera den önskade DC-avstämningsspänningen.

20



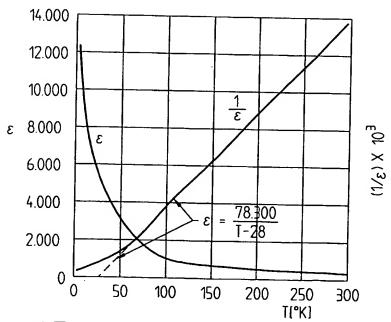


Fig.1B

2/7

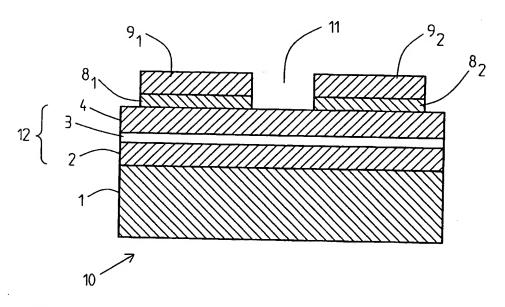
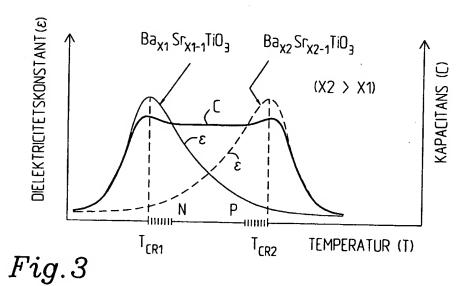


Fig.2



3/7

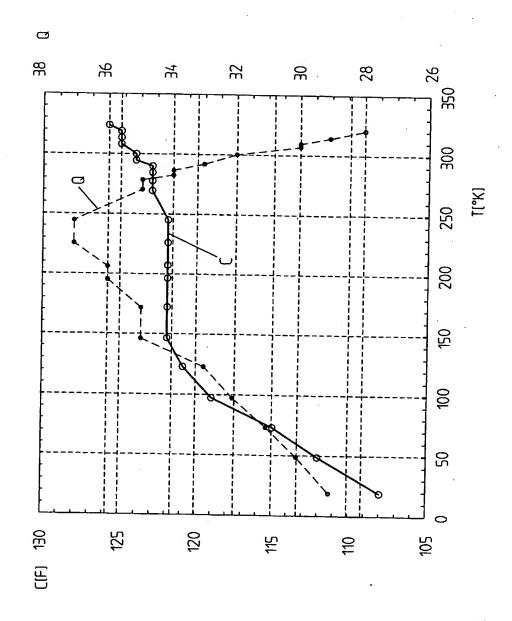


Fig. 4

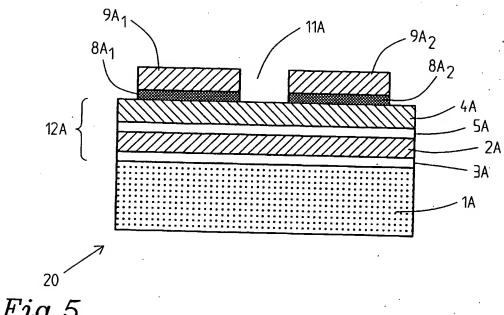


Fig.5

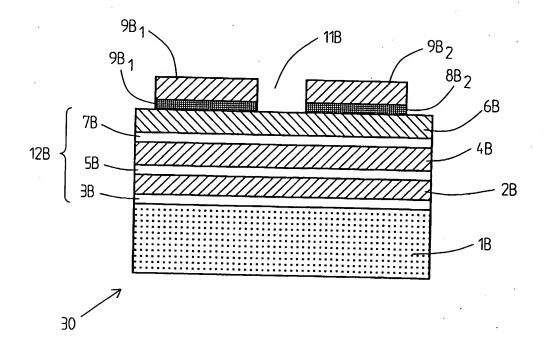


Fig.6

5/7

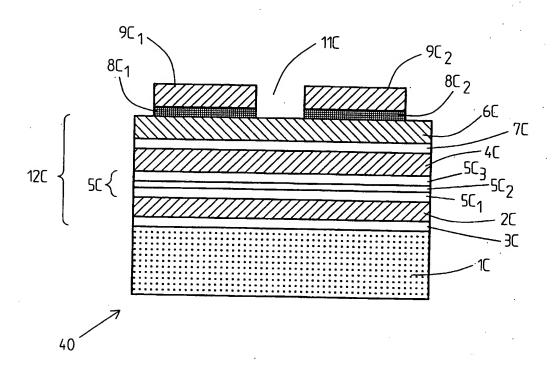


Fig. 7

6/7

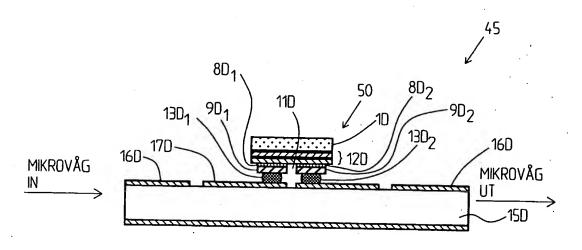


Fig. 8A

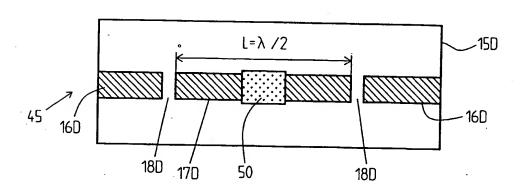


Fig.8B

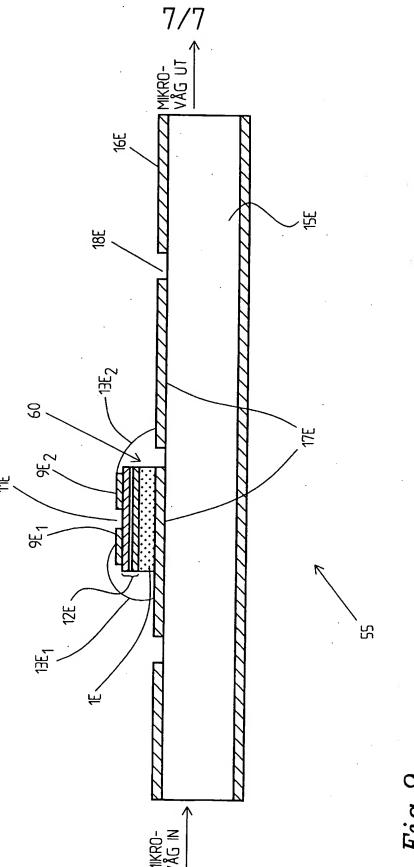


Fig.9